APS 科技

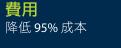
您知道嗎?

新的光罩氣體微顆粒偵測系統 (APSR) 是與晶圓氣體微顆粒偵測系統 (APS) 一樣具有革新的微顆粒偵測科技,這個先進的 技術現今已被晶圓廠和設備商廣泛使用。

光罩型式的氣體微顆粒偵測系統 (APSR) 能讓設備工程師節省機台維護與保養的時間,並同時降低成本。我們客戶已成 功驗證 88% 時間節省、降低高達 95% 成本與提高 20 倍的生產效率、人力卻只需傳統的量測技術的一半!









提升效率,從容得閒。 採用 WaferSense[®] 和 ReticleSense[™] 量測工具,

您知道嗎?

WaferSense 與 ReticleSense 已被大量廣泛運用於半導體晶圓廠、光罩廠與設備製造商,請您參考下列的成功案例:



ATS

APS

應用實例

應用實例

• Dry etch

Ion implant

Photo lithography

 Chemical vapor deposition; CVD, ALD Atomic layer deposition; ALD Wet (chemical) etch, plasma etch

Plasma vapor deposition; PVD

• Wet (chemical) etch, plasma etch

Automated handling system

Chemical vapor deposition; CVD, ALD



應用實例 Epitaxy

- Thermal oxidation/metallization
- Plasma vapor deposition; PVD
- Chemical vapor deposition; CVD, ALD • CMP
- Atomic layer deposition; ALD
- Photo lithography
- Wet (chemical) etch, plasma etch
- Dry etch
- Ion implant
- Diffusion/furnace
- Rapid thermal anneal; RTA, RTP
- Test and inspection
- Metrology
- Micro contamination
- Auto handling system; AMHS
- Module repair



- Photo Lithography
- Diffusion/Furnace
- Test and Inspection
- Rapid Thermal Anneal; RTA, RTP
- Metrology
- Microcontamination
- Auto Handling System; AMHS and Stockers

請您即刻聯繫 CyberOptics 與其代理商,來安排產品介紹、演示與免費的試用。



服務電話:美國 +1.763.542.5000;日本 +81.80.3974.0253;亞洲 +886.972.763.278 電子郵件:CSsales@cyberoptics.com 網站:www.cyberoptics.com





























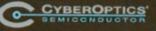














1

Made in USA Patent pending

WaferSense[®]與ReticleSense[™]革新的即時無線量測科技

當您需要最有效率與效能的量測工具來協助您安裝、調教與維護半導體製程設備,請採用 CyberOptics 的解決方 案!我們是類晶圓無線量測工具的全球領導廠商,多年來不斷研發創新技術,提供您即時的晶圓水平與垂直角 度、間隙、位置、震動與微顆粒的量測工具。

全球的一流半導體晶圓廠與主要設備製造商都倚賴精準可靠的 WaferSense 與 ReticleSense 來進一步改善良率與提 高生產力。

已經廣泛被驗證與採用

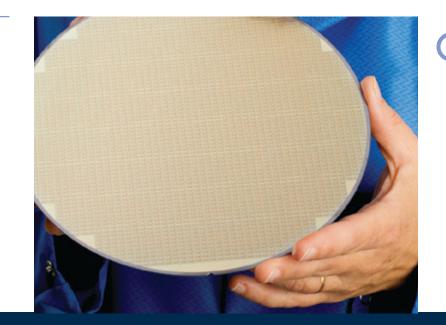
- 全球各大晶圓廠及主要設備商皆已採用 CyberOptics 即 時無線量測科技,來提升設備可生產時間及確保良率 並提升整體生產力。
- 愈來越多設備商與各大晶圓廠已採用 WaferSense 及 ReticleSense 為標準工具作為最佳解決方案 (BKM) 以符合愈 來愈先進製程的要求。

最佳效率與效能

- •我們首創將量測儀器進一步縮小,做成類晶圓或光罩 型式在設備中傳送,利用藍芽即時地將量測結果顯示 於遠端電腦軟體上,讓原本不可能的量測變得容易月 方便使用。
- 即使在真空或不開啟設備腔體的情況之下,您也可透 過設備的自動傳送裝置將Wafer Sense 和 Reticle Sense 傳到設備內部使用。
- •配合方便操作的軟體,運用無線技術將量測結果顯示並 記錄於電腦上以標準化您得作業流程。採用這種方便、 可靠、精準的量測科技,將比傳統的方法更能節省您寶 貴的時間和成本。

節省時間與成本

- ✓ 進一步改善良率與提升設備可生產時間
- ✔ 增加產量
- ✔ 降低人力
- ✓加速設備安裝時程、減少設備維護時間、快速診斷設備 問題及復原給牛產線使用
- ✓ 讓設備快速保持穩定與標準的最佳狀態
- ✓ 簡化工作流程
- ✔ 建立可重複、可驗證的標準作業流程





以提升製程均匀度和跨機台的一致性。 • 隨機附有 LevelView[™]、LevelReview[™]軟體。

ReticleSense 光罩型式的即時無線量測系統

APSR



即時監控、偵測光罩處在的製程設備裡或自動傳

- 送系統中氣體環境微顆粒,可偵測的最小粒徑達 0.15 微米。 讓您容易判別微顆粒產生的位置及時間點 , 及瞭
- 解微顆粒的清除成效和設備維修結果。
- 隨機附有 Particle View™、ParticleReview™軟體。

新上市!

WaferSense 晶圓型式的即時無線量測系統 備有6吋、8吋、12吋、以及18吋供您選擇

-	ATS
装置	• 讓您"看"見晶圓在設備內部的位置並擷取
.15	X,Y,Z 軸的位置偏差數值以方便調教,精準 度達 100 微米。
瞭解	 ・精確的晶圓位置傳送調教能降地傳送時損傷、改善產品的製程瑕疵、降地微顆粒污染
豊。	的產生並進一步提升良率。
	• 隨機附有 TeachView™, TeachReview™ 和
	TeachTarget™軟體。
-	AGS
	晶圓間隙量測系統 (AGS)
ē使 浅達	• 在真空條件下,以非接觸的方式讓您快速量 測晶圓和上方金屬板的間隙和平行度,廣泛 被應用於薄膜製程的氣相沉積 (CVD) 與濺鍍
,	(PVD)的和乾蝕刻設備的精確調教,以達到 製程的最佳均匀度。
	 改善製程均匀性與再現性並提高設備可生產時間。
	• 隨機附有 GapView™、GapReview™ 軟體。
-	
斜角度	Wafer Mapper EXQ 晶圓感測器
對水	•可靠與快速偵測半導體晶圓在晶舟或 FOUPs 裡的數量及位置。
需要	 針對特別薄的晶圓或因製程導致暗色的晶圓表面,一樣能正常地偵測。能同時用於不同尺寸的晶圓偵測,不必因晶圓尺



光罩水平量測系統 (ALSR)

- 迅速量測光罩靜置時的水平 X 與 Y 軸方向的 傾斜角度與高度差,確保光罩在設備中每個 傳送點的相對水平,以降低光罩刮傷及損傷 的產生。
- 快速與精確地設定光罩在機台製程時的水平角 度,以提升製程均匀度和跨機台的一致性。
- 隨機附有 LevelView[™]、LevelReview[™]軟體。

